

## ЛИТЕРАТУРА

- [1] Suhl H. // J. Phys. Chem. Solids. 1957. 1, N 4. P. 209. [2] Schläpman E., Joseph R. // J. Appl. Phys. 1961. 32, N 6. P. 1006. [3] Мелков Г. А. // ЖЭТФ. 1976. 70. С. 1325. [4] Мелков Г. А., Шолом С. В. // ФТТ. 1987. 29. С. 3257. [5] Львов В. С., Рубенчик А. Н. Препринт ИАН СО АН СССР № 31. Новосибирск, 1976. [6] Черепанов В. Б. Некоторые вопросы нелинейной теории параметрического возбуждения волн: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Новосибирск, 1980. [7] Горшков А. С., Марченко В. С., Цельковский А. Ф. // ЖТФ. 1968. 38. С. 379. [8] Горшков А. С., Лаврова О. А. // Радиотехн. и электроника. 1968. 13. С. 1516. [9] Яковлев Ю. М., Генделев С. Ш. Монокристаллы ферритов в радиоэлектронике. М., 1975. [10] Patton C. E. // Proc. Int. Conf. Ferrites. Kyoto, Japan, 1970. P. 524. [11] Sparks M. Ferromagnetic Relaxation Theory. N. Y., L., 1964. [12] Kabos P., Wilber W. D., Patton C. E. // Proc. 7th Int. Conf. on Microwave Ferrites. CSSR, Smolenice, 1984. P. 23. [13] Patton C. E., Jantz W. // J. Appl. Phys. 1979. 50, N 11. P. 7082.

Поступила в редакцию  
16.06.93

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1994. Т. 35, № 2

УДК 533.951

### О СТАЦИОНАРНОМ СОСТОЯНИИ ПЛОСКОГО ДИОДА

И. М. Алешин, Л. С. Кузьменков

(кафедра теоретической физики)

Исследовано стационарное состояние плоского диода на основе кинетической теории. Показано, что в отличие от результатов расчета в рамках холодной гидродинамики электронная плотность в диоде везде конечна, а ее максимальное значение определяется входным током и температурой частиц. Полученные результаты могут быть полезны для расчета приборов с виртуальным катодом.

Стационарное состояние плоского диода подробно исследовано для двух предельных значений параметра  $\xi \equiv v_T/v_0$ :  $\xi=0$  и  $\xi=\infty$ , где  $v_T = (T/m)^{1/2}$  — тепловая скорость частиц,  $v_0$  — средняя скорость инжекции (см., напр., [1, 2]). В отличие от случая нулевой скорости инжекции пучка ( $\xi=0$ ) при  $\xi \gg 1$  переход в режим значительного отражения частиц от виртуального катода происходит скачком, когда при увеличении безразмерного тока  $I = 4\pi n_0 e^2 d^2 / m v_0^2$  его величина превысит некоторое значение  $I_1$  ( $e$ ,  $n_0$  — заряд электронов и их плотность у катода соответственно,  $d$  — расстояние между электродами). Изменение параметра  $I$  в обратную сторону приводит к выходу из этого режима, но при  $I_2 < I_1$ . Расчеты значений  $I_1$  и  $I_2$  для нулевой температуры электронов приведены в [1, 2].

Ниже показано, что при увеличении температуры частиц ток  $I_1$  уменьшается, в то время как  $I_2$ , наоборот, возрастает, так что при некотором значении  $\xi = \xi^*$  величина  $I_1$  становится равной  $I_2$  и явление скачка потенциала уже не имеет места. При конечном значении  $\xi$  электронная плотность конечна в любой точке внутри диода. Ее максимальная величина оказывается порядка  $1/V\xi$ . Таким образом, в диоде достигается тем большее значение максимума плотности, чем меньше тепловой разброс скоростей электронов. Представляло бы интерес проверить экспериментально эту простую количественную зависимость. С теоретической точки зрения использование кинетической теории для расчета процессов в диоде имеет преимущество по сравнению с методами холодной гидродинамики, приводящими к бесконечному значению электронной плотности [3]. Поэтому для решения задачи ниже используются уравнения физической кинетики.

Для электронного потока достаточно высокой плотности справедливо бесстолкновительное приближение. Функция распределения частиц  $f$  и электрический потенциал  $\Phi$  удовлетворяют в этом случае системе уравнений Власова—Пуассона. В стационарном случае имеем

$$u \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{2} \frac{d\varphi}{dx} \frac{\partial f}{\partial u} = 0, \quad (1a)$$

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -2I \int_{-\infty}^{\infty} df(u, \varphi(x)).$$

Граничные условия на катоде и аноде имеют вид

$$\varphi(0) = \varphi_1, \quad \varphi(1) = \varphi_2, \quad (1б)$$

и

$$f(0) = f_0(u). \quad (1в)$$

Здесь введены безразмерные величины  $u = v_z/v_0$ ,  $\varphi = 2e\Phi/mv_0^2$  и  $x = z/d$ , где  $z$  — координата вдоль направления пучка. Предполагается, как обычно [1], что создано сильное магнитное поле, перпендикулярное пластинам диода, так что движение электронов одномерно. Кроме того, для простоты положим  $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ .

Решение первого уравнения (1а) есть произвольная функция интегралов движения уравнений для характеристик. В стационарном случае имеется лишь один нетривиальный интеграл  $\sigma \equiv u^2 + \varphi(x)$ , так что  $f = f(\sigma)$ . Явный вид зависимости  $f(\sigma)$  определяется из граничного условия (1в).

Используя полученное решение, уравнения (1а) можно свести к уравнениям только для потенциала:

$$\frac{d^2\varphi_\alpha}{dx^2} = -2I \left[ \frac{n_\beta}{n_0} \int_{\sqrt{\varphi_m - \varphi}}^{\infty} f(\sigma) du + 2 \frac{n_\alpha}{n_0} \int_0^{\sqrt{\varphi_m - \varphi}} f(\sigma) du \right] \equiv -2IN_\alpha(\varphi), \quad (2a)$$

$$\frac{d^2\varphi_\beta}{dx^2} = -2I \frac{n_\beta}{n_0} \int_{\sqrt{\varphi_m - \varphi}}^{\infty} f(\sigma) du \equiv -2IN_\beta(\varphi). \quad (2б)$$

Здесь индексы « $\alpha$ » и « $\beta$ » относятся к областям  $(0, x_m)$  и  $[x_m, 1]$  соответственно,  $\varphi_m$  — максимальное значение потенциала  $\varphi$ , которое достигается в плоскости  $x = x_m$ ,

$$\frac{n_\alpha}{n_0} = \int_0^{\sqrt{\varphi_m}} f_0(u) du, \quad \frac{n_\beta}{n_0} = \int_{\sqrt{\varphi_m}}^{\infty} f_0(u) du, \quad n_\alpha + n_\beta = n_0. \quad (2в)$$

Выберем  $f_0$  в виде максвелловского распределения, сдвинутого от начала координат на величину  $v_0$  в пространстве скоростей. Если  $\varphi_m < (1 - \xi)^2$ , то током отраженных частиц можно пренебречь. При этом  $n_\alpha \approx 0$ ,  $n_\beta \approx n_0$  и уравнения (2а) и (2б) совпадают. Тогда в режиме полного прохождения тока при любых  $x \in [0, 1]$  справедливо уравнение

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -2I \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}} \int_{\sqrt{\varphi_m - \varphi}}^{\infty} \exp\{-\lambda(1 - (1 - \sqrt{u^2 + \varphi})^2)\} du \equiv 2IN(\varphi), \quad (3)$$

$$\lambda \equiv mv_0^2/(2T) = 1/(2\xi^2).$$

Для вычисления интеграла в (3) при низких температурах электронов ( $\lambda \gg 1$ ) можно использовать асимптотический метод Лапласа. Такой метод применялся в [4]. Однако полученные там выражения не справедливы при  $\varphi \approx 1$ , так как при этом условии подэкспоненциальное выражение имеет в точке своего минимума ноль четвертого, а не второго порядка, в отличие от случая  $\varphi < 1$  [5]. Физически это соответствует появлению значительного тока отражения частиц. Асимптотические значения правой части (3) имеют вид

$$N(\varphi) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1-\varphi}} + \frac{3\varphi}{4\lambda(1-\varphi)^{5/2}}, & \varphi < \varphi^*, \\ \frac{\lambda}{2\sqrt{2\pi}} \left( \varphi \Gamma(3/4) + \Gamma(1/4) \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right), & \varphi > \varphi^*. \end{cases} \quad (4)$$

Значение  $\varphi^* \approx 1 - 1,5\lambda^{-1/4}$  определяется из условия непрерывности асимптотики (4) в этой точке.

Интегрируя (3) с использованием функции  $N(\varphi)$  из (4) два раза и учитывая граничные условия (16) и условие  $\varphi'(x_m) = 0$ , получаем неявную зависимость максимума потенциала  $\varphi_m$  от параметра  $I$  (как известно, для каждого  $I \in (I_2, I_1)$  существует три значения  $\varphi_m$  [1, 2]):

$$I = \left[ \int_0^{\varphi_m} \frac{d\varphi}{\sqrt{M(\varphi) - M(\varphi^*)}} \right]^2, \quad (5)$$

$$M(\varphi) \equiv \int_0^{\varphi} N(\varphi) d\varphi.$$

Из (5) следует выражение для критического тока  $I_1$ , найденное ранее в [4]:

$$I_1 \approx I_{1\text{cold}} (1 - a_1/\lambda) + O(1/\lambda^2). \quad (6a)$$

Формулы (4)–(5) позволяют кроме этого получить аналитическую формулу для критического тока  $I_2$ , определяемого равенством

$$I_2 = \left[ \int_0^{\varphi^*} \frac{d\varphi}{\sqrt{M(\varphi) - M(\varphi^*)}} \right]^2. \quad (6b)$$

Эта формула имеет вид

$$I_2 \approx I_{2\text{cold}} (1 + 1,2/\lambda^{1/4} - 3,52/\lambda^{1/2} + 7,9/\lambda^{3/4} - 6,2/\lambda) + o(1/\lambda). \quad (6в)$$

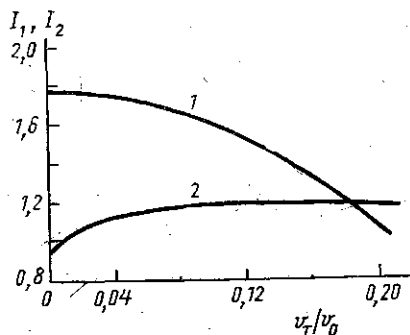


Рис. 1. Температурная зависимость предельных токов  $I_1$  (1) и  $I_2$  (2)

Здесь  $I_{1\text{cold}}$ ,  $I_{2\text{cold}}$  — гидродинамические значения величин  $I_1$ ,  $I_2$ ;  $a_1$  — константа.

На рис. 1 приведены графики зависимостей (6a) и (6в). Асимптотика (6в) практически совпадает с кривой, полученной из численных расчетов по формуле (6б). Из рисунка видно, что при некотором  $\xi = v_T/v_0$  величина  $I_1$  становится равной  $I_2$ . Зависимость  $\varphi_m(I)$  при этом становится однозначной, т. е. скачок потенциала не имеет места.

Для расчетов пространственного распределения электрического потенциала и электронной плотности при конечной температуре частиц удобно вместо максвелловского распределения использовать модельное:

$$f_0 = \frac{n_0}{2q} \Theta(q^2 - (1-u)^2), \quad q = \Delta v/v_0 < 1, \quad (7)$$

$\Theta(x)$  — функция Хевисайда. То есть скорости влетающих электронов распределены равномерно относительно  $v_0$ , ширина функции распределения равна  $2\Delta v$ . Тогда интегралы в (2) вычисляются точно. В результате вычислений находим

$$N_\alpha = \frac{1}{2q} \begin{cases} 0, & \Phi_m < (1-q)^2, \\ \sqrt{\Phi_m - \varphi} - \sqrt{(1-q)^2 - \varphi}, & \varphi < (1+q)^2 \text{ \& } (1-q)^2 < \Phi_m < (1+q)^2, \\ \sqrt{\Phi_m - \varphi}, & (1-q)^2 < \varphi < (1+q)^2 \text{ \& } \\ & \text{\& } (1-q)^2 < \Phi_m < (1+q)^2, \end{cases} \quad (8a)$$

$$N_\beta = \frac{1}{2q} \begin{cases} \sqrt{(1+q)^2 - \varphi} - \sqrt{(1-q)^2 - \varphi}, & \Phi_m < (1-q)^2, \\ \sqrt{(1+q)^2 - \varphi} - \sqrt{\Phi_m - \varphi}, & (1-q)^2 < \Phi_m < (1+q)^2, \\ 0, & \Phi_m > (1+q)^2, \end{cases} \quad (8б)$$

$$\frac{n_\alpha}{n_0} = \frac{1}{2q} \begin{cases} 0, & n_\beta = \frac{1}{2q} \begin{cases} 1+q - \sqrt{\Phi_m}, & \Phi_m < (1-q)^2, \\ 0, & (1-q)^2 < \Phi_m < (1+q)^2. \end{cases} \end{cases} \quad (8в)$$

Из (8) следует, что безразмерная электронная плотность  $2IN_{\alpha,\beta}$  при конечных значениях  $q$  ( $\sim \xi$ ) конечна и пропорциональна  $1/\sqrt{\xi}$ . При малых  $q$  формулы (8а—8в) переходят в (4), если положить  $q=3^{1/2}\xi$ . При этом условии для низких температур электронов максвелловское распределение хорошо аппроксимируется распределением (7). Используя (8а, б) и интегрируя уравнения (2а)—(2б) два раза, получаем решение уравнений (2) в квадратурах:

$$x - x_m = \mp \frac{1}{\sqrt{4I}} \int_{\varphi_{\alpha,\beta}}^{\varphi_m} dz \cdot Q_{\alpha,\beta}^{-1/2}(z, \varphi_m), \quad (9)$$

$$Q_{\alpha,\beta} = M_{\alpha,\beta}(\varphi_{\alpha,\beta}, \varphi_m) - M_{\alpha,\beta}(\varphi_m, \varphi_m),$$

а с учетом граничных условий — неявные зависимости  $\varphi_m(I)$  и  $x_m(I)$ :

$$I = (R_\alpha + R_\beta)^2/4, \quad x_m = R_\alpha/(R_\alpha + R_\beta), \quad R_{\alpha,\beta} = \int_0^{\varphi_m} dz \cdot Q_{\alpha,\beta}^{-1/2}(z, \varphi_m).$$

Последовательность кривых 1—5 на рис. 2 иллюстрирует динамику пространственного распределения плотности заряда и потенциала в диоде при изменении значения  $\varphi_m$  от  $(1-\xi)^2$  до  $(1+\xi)^2$ . С возрастанием тока начиная от величины  $I_2$  ( $\varphi_m = (1-\xi)^2$ ) кривые  $N(x)$  и  $\varphi(x)$  становятся несимметричными относительно центра прибора. Происходит размывание максимума плотности (кривая 1), при этом тепловой разброс электронов приводит к его раздвоению (кривая 2). Дальнейшее увеличение входного тока разрушает это состояние (кривые 3—5). Для наблюдения раздвоения максимума концентрации частиц можно, например, поместить в диод дополнительный электрод в плоскости  $x=x_m$

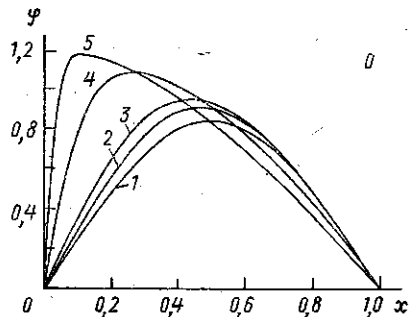
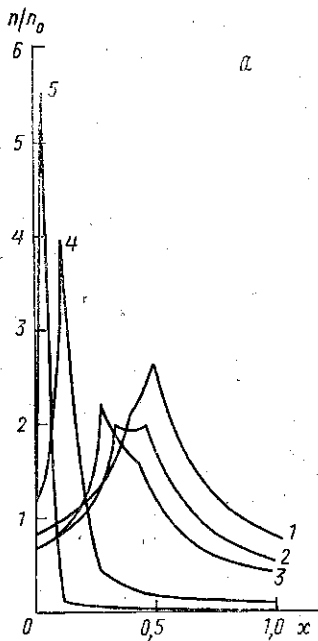
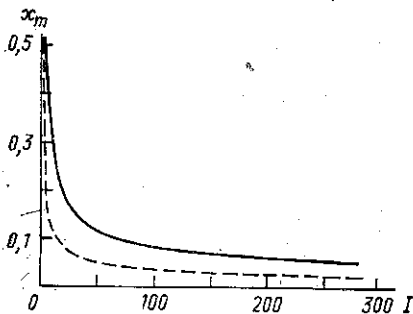


Рис. 2. Пространственная зависимость безразмерных плотности электронов (а) и потенциала (б) в диоде для значений  $\Phi_m = (1-q)^2 + kq$ , где  $q=0,1$ ;  $k=0,4$  (1); 0,6 (2); 1 (3); 2,1 (4) и 3,6 (5)

при потенциале  $\Phi = \Phi_m$ , так как состояние с большим отраженным током частиц неустойчиво относительно колебаний виртуального катода [6]. Отметим, что явление имеет место для ленгмюровских волн большой амплитуды [5].



На рис. 3 изображена зависимость положения виртуального катода ( $x_m$ ) при двух разных значениях  $q$ . При фиксированном значении входного тока  $I$  виртуальный катод образуется тем ближе к аноду, чем выше температура частиц.

Рис. 3. Зависимость координаты виртуального катода  $x_m$  от входного тока  $I$  для  $q=0$  (штриховая кривая) и  $q=0,1$  (сплошная)

#### ЛИТЕРАТУРА

- [1] Гвоздовер С. Д. Теория электронных приборов сверхвысоких частот. М., 1956. [2] Кирштейн П. Т. и др. Формирование электронных пучков. М., 1970. [3] Coutsiias E. A.//J. Plasma Phys. 1988. 40. P. 369. [4] Coutsiias E. A.//J. Plasma Phys. 1984. 31. P. 313. [5] Алешин И. М., Дрофа М. А., Кузьменков Л. С.//Физ. плазмы. 1993. 19. С. 1004. [6] Coutsiias E. A.//Phys. Rev. 1983. A 27. P. 1535.

Поступила в редакцию  
15.09.93